

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 7 部門第 2 区分
 【発行日】平成29年2月9日 (2017.2.9)

【公開番号】特開2014-209595(P2014-209595A)
 【公開日】平成26年11月6日 (2014.11.6)
 【年通号数】公開・登録公報2014-061
 【出願番号】特願2014-55836(P2014-55836)
 【国際特許分類】

H 0 1 L 21/304 (2006.01)

H 0 1 L 21/027 (2006.01)

G 0 2 F 1/13 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/304 6 4 2 Z

H 0 1 L 21/30 5 7 2 B

G 0 2 F 1/13 1 0 1

【手続補正書】

【提出日】平成28年12月21日 (2016.12.21)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

液体を貯留する処理槽と、

パターンが第 1 の面に形成され透光性を有する処理対象基板を、その第 1 の面を前記処理槽内の液体の液面に密着させて保持する保持部と、

前記保持部により保持された前記処理対象基板に対し、前記第 1 の面に対向する第 2 の面側よりレーザ光を照射する照射部と、
 を備えることを特徴とする基板処理装置。

【請求項 2】

前記レーザ光の集点は前記処理対象基板の第 1 の面から前記パターンの高さの範囲内であることを特徴とする請求項 1 に記載の基板処理装置。

【請求項 3】

前記液体はガス飽和液又はガス過飽和液であることを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載の基板処理装置。

【請求項 4】

パターンが第 1 の面に形成され透光性を有する処理対象基板を、その第 1 の面を処理槽内の液体の液面に密着させて保持する工程と、

保持した前記処理対象基板に対し、前記第 1 の面に対向する第 2 の面側よりレーザ光を照射する工程と、
 を有することを特徴とする基板処理方法。

【請求項 5】

パターンが第 1 の面に形成され透光性を有する処理対象基板を、その第 1 の面を処理槽内の薬液の液面に密着させて保持する工程と、

前記第 1 の面を前記処理槽内の薬液の液面に密着させて保持した前記処理対象基板に対し、前記第 1 の面に対向する第 2 の面側よりレーザ光を照射する工程と、

レーザ光の照射後、前記処理槽内の薬液を純水に置換する工程と、

前記第 1 の面を前記処理槽内の純水の液面に密着させて保持した前記処理対象基板に対し、前記第 1 の面に対向する第 2 の面側よりレーザ光を照射する工程と、
を有することを特徴とする基板処理方法。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0007

【補正方法】削除

【補正の内容】

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0010

【補正方法】削除

【補正の内容】